2026年度 第2回ARIM量子・電子マテリアル領域セミナー

ポスト5G時代のリソグラフィ技術

産業技術総合研究所、東京科学大学、物質・材料研究機構、北海道大学は、2021年度からスタートした文部科学省委託事業である「マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）」の一環として、『**ポスト5G時代のリソグラフィ技術**』と題してセミナーを2027年 1月26日（火）にハイブリッド開催いたします。EUVリソグラフィや電子線リソグラフィに関わる技術の解説に加え、各機関の共用施設の電子線描画システム等についても紹介いたします。産学官いずれのご所属の方々の奮ってのご参加をお待ちしております。

◇講演会

【日時】2027年1月26日（火）13:00～16:20
【オンサイト会場】産業技術総合研究所つくば中央2-12棟第6会議室
http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html
【オンライン】Microsoft Teamsによるウェビナー配信（参加登録者へ別途URLをお送りいたします。）
【定員】オンサイト：80 名、オンライン：200名（先着順、参加登録をお願いします）
【セミナー案内/申し込み】 https://www.tia-kyoyo.jp/npf/seminar/2026-2/
【参加費】無料
【連絡先メールアドレス】tia-npf-school2@aist.go.jp

◇講演プログラム

13:00-13:10　冒頭あいさつとARIM、ナノプロセシング施設の電子線描画システムの紹介
産業技術総合研究所ナノプロセシング施設運営室 松本 壮平

13:10-13:50　EUV露光の原理、現状と今後の展開（産総研半導体拠点と絡めて）
産業技術総合研究所先端半導体研究センター　井谷 俊郎

13:50-14:00　北海道大学共用施設の電子線描画システム
北海道大学　松尾 保孝

14:00-14:30　光子と電子から見るEUV/BEUVレジスト反応～短波長レジスト感度と低エネルギー電子照射～
兵庫県立大学　原田 哲男

14:30-14:40　東京科学大共用施設の電子線描画装置を中心としたMIX＆MATCHシステム
東京科学大学　宮本 恭幸

14:40-14:55　休憩

14:55-15:05　EB描画パターン解析のための高品質データ収集とDB構築
物質・材料研究機構　大里 啓孝

15:05-15:35　EB / EUVリソグラフィ用メタルレジストのリソグラフィ性能評価
量子科学技術研究開発機構(QST)　山本 洋揮

15:35-15:45　QSTの放射光先端計測装置群
量子科学技術研究開発機構　佐々木 拓生

15:45-16:15　自己整合ダブルパターニング（SADP）互換EBリバーストーン技術による1Xナノゲート作製
産業技術総合研究所ハイブリッド機能集積研究部門　尹 成圓

16:15-16:20　終了の挨拶
産業技術総合研究所NPF運営室　栗津 浩一

主催：産業技術総合研究所ナノプロセシング施設（NPF）
共催：物質・材料研究機構 ARIMセンターハブ担当領域推進室
共催：東京科学大学 科学技術創成研究院未来産業技術研究所
共催：北海道大学グリーンナノテクノロジー研究センター
共催：量子科学技術研究開発機構（QST）放射光科学研究センター